(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/304

(11) 공개번호 특1997-0077279
(43) 공개일자 1997년12월12일

(21) 출원번호 특1996-0017920
(22) 출원일자 1996년05월25일

(71) 출원인 삼성전자 주식회사 김광호
경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지
(72) 발명자 이강용
서울특별시 노원구 월계 4동 279-3번지

*심사청구 : 없음*

# (54) 반도체장치의 드라이 스크라버

*요약*

반도체 공정설비에서 배출되는 배기가스에 포함된 오염물질을 제거하기 위하여 사용되는 드라이 스크라버에 있어서, 도관의 내벽에 오염물질이 부착되는 것을 방지하고 집진능력을 향상시킬 수 있는 반도체장치의 드라이 스크라이버에 관한 것이다.

본 발명의 드라이 스크라버는 배기가스가 유입되는 배기가스 유입부, 질소가스를 가열하는 질소가스 가열장치, 가열된 질소가스가 공급되는 질소가스 공급부, 배기가스로부터 오염물질을 제거하는 집진부 및 오염물질이 제거된 가스를 배출시키는 배기펌프로 구성된 것을 특징으로 한다.

따라서, 본 발명의 드라이 스크라버는 공정설비로부터 배출되는 배기가스의 오염도를 감소시켜 제조라인의 청정도를 향상시키는 효과가 있다.

*대표도*

*도2*

*명세서*

[발명의 명칭]

반도체장치의 드라이 스크라버

[도면의 간단한 설명]

제2도는 공정챔버펌프에 연결된 본 발명에 따른 드라이 스크라버의 일 실시예를 나타내는 개략도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

*(57) 청구의 범위*

**청구항 1**

배기가스가 유입되는 배기가스 유입부 ; 상기 배기가스 유입부로부터 유입된 배기가스를 운반하기 위하여 질소가스 공급원으로부터 공급되는 질소가스를 가열하는 질소가스 가열장치 ; 상기 질소가스 가열장치에서 가열된 질소가스가 공급되는 질소가스 공급부 ; 상기 질소가스 공급부로부터 공급된 질소가스에 의해 운반된 상기 배기가스로부터 오염물질을 제거하는 집진부 ; 및 상기 집진부에서 오염물질이 제거된 가스를 배출시키는 배기펌프 ; 로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 드라이 스크라버.

**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 질소가스는 약 80-120도 정도로 가열되는 것을 특징으로 하는 상기 반도체장치의 드라이 스크라버.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

*도면*

도면2

